

Príprava submikrometrových štruktúr elektrónovou litografiou.

P. Durina 1, T. Roch 1, M. Stefecka 1,2, I. Kostic 1,3, P. Schlosser 1, T. Plecenik 1, P. Kúš 1, A. Plecenik 1

1 Katedra experimentálnej fyziky, FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynska dolina F2, 84248 Bratislava

2 BIONT a.s., Karloveská 63, 842 29 Bratislava

3 Ústav informatiky SAV, Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava

durina.pavol@gmail.com

V práci sa zaoberáme prípravou submikrometrových štruktúr v reziste PMMA pomocou elektrónovej litografie (EBL) pre následnú prípravu kovových kontaktov na substráte Al₂₀_3 v procese suchého leptania. Tieto štruktúry sú určené na skúmanie transportných vlastností materiálov ako napríklad, TiO₂, MgB₂ a supravodivých tenkých vrstiev určených pre aplikácie v senzorike. Prezentované sú porovnania štruktúr v závislosti od parametrov expozície a vlastností rezistu.